



Chemical highly accurate Mechanical Planarizer

# ChaMP

## Chemical Mechanical Planarizers

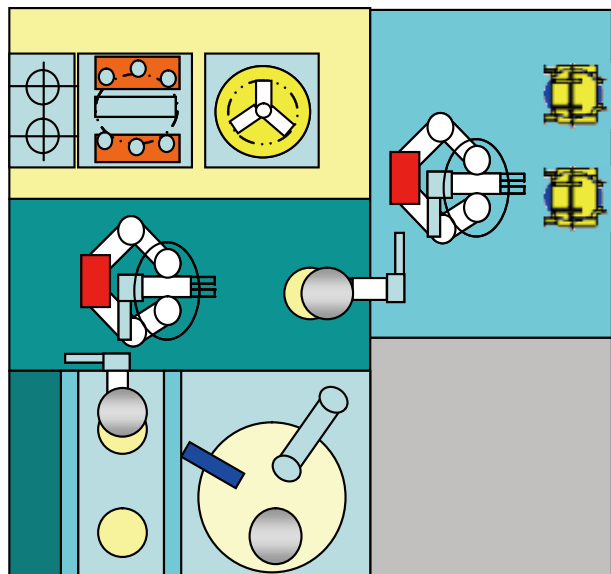
### 小型 CMP 装置

#### 特徴

- 低価格
  - 小フットプリント
  - 高性能 CMP → 半導体デバイス量産ラインで培った技術を搭載
  - お客様のご要望に応じて、装置仕様変更が可能 → R&D から試作、量産まで拡張可能
- 
- 2～12インチ研磨ヘッドを提供可能 → 同じボディ上で、異なるウェーハサイズの研磨が可能
  - ウェーハローダ搭載により、フルオート動作が可能
  - 洗浄ユニット搭載により精密洗浄が可能



株式会社東京精密



【仕様①】  
セミオートタイプ CMP 装置



【仕様②】  
簡易ローダー付自動 CMP 装置

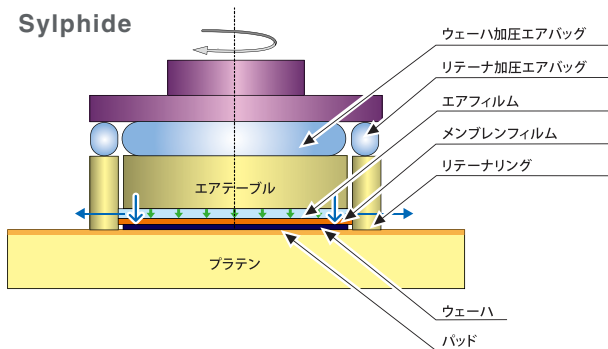
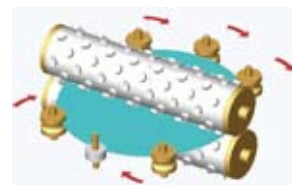


【仕様③】  
ローダー & 洗浄機付き自動 CMP 装置

※洗浄機単体での販売も可能です

## エアフロート式ヘッド “Sylphide”

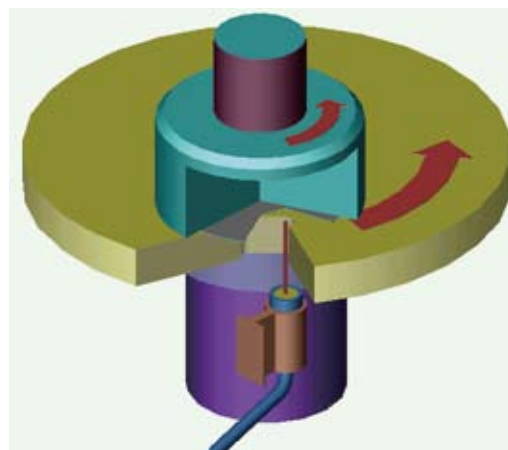
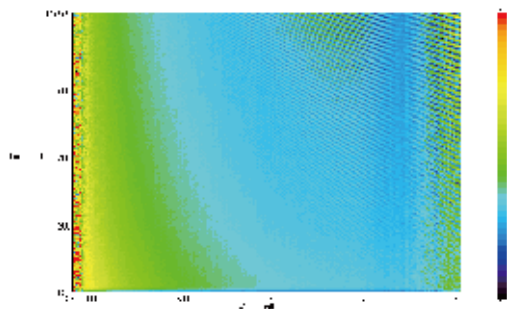
- エアフィルム形成により、ウェーハ面内で非常に均一な加圧を実現
- エアフィルムと独立したエアバッグを持つことで低圧での安定性を実現
- 独立したリテーナ加圧エアバッグにより良好なエッジプロファイル制御を実現
- リテーナ・メンブレンのワンタッチ交換によるダウンタイムの低減（下記参照）
- ゾーンコントロール機能の追加可能（オプション）



## Optical End-Point Detection System

- 白色光源を用い、広い波長領域の反射データと特殊アルゴリズムで正確に残膜変化を検出

- 幅広いアプリケーションの提供



量産に向けての各種オプション機能をご用意しています。

### ■半導体製造機器取扱営業所

東京営業所  
大阪営業所  
九州営業所

TEL : (042)631-5211  
TEL : (06)6821-0361  
TEL : (097)538-1985

FAX : (042)631-5234  
FAX : (06)6821-0210  
FAX : (097)538-1989